2019A0000　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　BL19B2

**○○における△△の解析**

**Analysis on △△ for ○○**

**（課題名/Title - bold）**

（英文タイトル中の単語[名詞,動詞,形容詞,副詞]は、語頭だけ大文字にして下さい。）

高輝度 太郎a, 産業 花子b

Taro Kokidoa, Hanako Sangyob

（著者/共著者/Author：実験責任者にはアンダーライン）

a(公財)高輝度光科学研究センター, b(株)重点産業工業

　aJASRI, bJutensangyo Industrial. Co. Ltd.

（所属機関/Affiliation）

（アブストラクト／和文　200字程度）目的、方法、重要な結果等を、簡潔明瞭にご記載下さい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

**キーワード：**　Ａ、Ｂ、Ｃ　測定対象、測定手法、測定目的、解析手法など

**背景と研究目的：**

該当する課題申請内容を参考にご記載ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [1]、

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

**実験：**

他施設での実験結果についても可能な範囲でご記載ください。

測定試料、測定条件について下記を参考に具体的にご記載下さい。（単位は原則SI単位系で、数値と単位の間には半角分のスペースを入れて下さい。なお、物理量はイタリック（例*d*（格子面間隔）、*q*（波数）等）で記載してください）

**試料**：試料名とその特徴（例：形状、組成、製法、物性、機能等）

**実験条件**：実施ビームライン。（他施設のビームラインもご記載ください）

**・回折・散乱の場合**

X線エネルギー（波長）、入射X線形状（サイズ、スリット開口）、使用装置

多軸回折装置　受光側コリメーション（スリット開口、ソーラースリット発散角）、検出器（PILATUS,シンチレーションカウンタ等）

　　　小角散乱　カメラ長（較正方法も含む）、検出器、露光時間

　　　粉末回折　キャピラリー材質と径、（露光時間）

**・XAFSの場合**

測定対象元素と吸収端（K, LI, LII, LIII）、モノクロ結晶面方位、測定手法（透過、蛍光、CEY）、蛍光法XAFSの検出器（19SSD、Lytle(ガス種)）、斜入射の場合は入射角（全反射であれば、臨界角に対する関係）

**・HAXPESの場合**

X線エネルギー（較正方法も含む）、パスエネルギー、スリット形状、光電子検出角度（TOA）、中和銃使用有無

**・イメージングの場合**

X線エネルギー、入射光形状、検出器、（露光時間）

　　　屈折コントラスト　カメラ長

　　　CT　試料方位角間隔（再構成に用いた画像数）

**・その他測定環境条件**（試料温度、試料雰囲気など）

必要に応じて、測定装置レイアウトを図示して下さい

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[2]。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[3]。

 表1．＊＊＊＊＊＊＊（説明文を日本語で入れて下さい。）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

**結果および考察：**

下記を参考に、図表を用いて測定結果を具体的にわかりやすくご記載下さい。

**図について**：bmp.、gif.、jpg.、png.、（tif.）で貼付けて下さい。（PDFの貼付けは不可）

縦軸、横軸ともに量の名称（散乱角、2θ、波数、q等）単位を忘れずにご記載下さい。量は一般的な名称でご記載下さい（例：XAFSでχ(R)は不可）。

**\*ご注意 冊子(紙媒体)ではグレースケールで印刷されます。WEBではフルカラーで掲載されます。**

**・回折・散乱の場合**

多軸回折装置

　　　典型的な測定データ（通常は、検出強度-散乱角）

　　小角散乱

　　　二次元測定データ及びI-qの一次元化データ

　　粉末回折

　　　典型的な測定データ（I-q　もしくはI-2θ）

**・XAFSの場合**

XANES

測定したXANESスペクトル

　　EXAFS

knχ(k):n=1,2,3、RSFは必須。配位数、配位距離導出の場合は、knχ(k)等のfitting結果も必須

　　　測定したXAFSスペクトルの典型例があることが望ましい。

**・HAXPESの場合**

　　測定スペクトル、（profile fittingをした場合はバックグラウンド推定法を記載）

**・イメージングの場合**

　　像、もしくは再構成イメージや断層図

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

**今後の課題：**（必要であれば）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

**参考文献：**（本文中では　[ ]で引用を示してください）

[1] T. Kokido, H. Sangyo, *Chem. Phys*. Rev. **104**, 4891 (2004).（論文タイトルは不要です）

[2] T. Kokido, in“Photochemistry and Photophisics”, H. Sangyo, ed., JASRI Press, Sayo, 1990, Chapter 4, P. 119.

[3] 高輝度太郎、産業花子、SPring-8利用者情報、**14** (2), 77 (2009).

[4] 高輝度三郎　他、平成22年度　重点産業利用課題報告書(2010A), pp. 299, 2010A1783.

(著者が3名以上の場合は筆頭者のみを記載してください。最後に課題番号を記載してください)

**雑誌の場合**

　[文献番号]　著者名, *雑誌名*(英文の時はイタリックで), **巻番号**(ボールドで), ページ, (発行年).

**単行本の場合**

[文献番号]　著者名, 書名(ローマンで), 編集者名, 出版社, 出版場所, 発行年, 章番号又はページ.

**・原則2ページ以上4ページまでで作成して下さい。**

**・図、表は文中に必ず入れて下さい。**

**・引用文献については、文献番号を文中で明記して下さい。**

**・一般的でない略語は原則として、何の略語かを本文中の初出のところで明記して下さい。**

**・タイトルには原則として、略語を使わないで下さい。**

**・本文および図表中の物理量を表す記号は、イタリックで表示して下さい。**

**・書式詳細は、別紙（書式　F15\_IA\_format）をご参照下さい。**

**・当報告書作成に使用した機器の「OS」および「アプリケーション」の名称を欄外へ記載して下さい。**